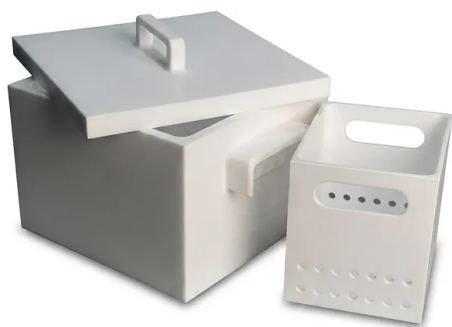


Serbatoio Quadrato Personalizzato In Ptfе Per Ammollo, Pulizia E Filtrazione Acido-Resistente Per Semiconduttori In Fluoropolimero

Numero articolo: PL-CP53



introduzione

Massimizza l'efficienza nella fabbricazione dei semiconduttori con i nostri serbatoi quadrati personalizzati in PTFE, progettati per una resistenza agli acidi superiore e la purezza necessaria per l'analisi di tracce. Questi recipienti ad alte prestazioni in fluoropolimero garantiscono un ammollo privo di contaminanti e una gestione chimica affidabile per i processi industriali e di laboratorio più esigenti di oggi.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Incisione di Wafer per Semiconduttori	Immersione di wafer di silicio in bagni di acido concentrato per la modifica della superficie e la rimozione di contaminanti.	Previene la contaminazione da ioni metallici e resiste a miscele aggressive di HF/HNO ₃ .
Lavorazione di Celle Solari	Testurizzazione e pulizia di substrati di silicio nelle linee di produzione fotovoltaica su larga scala.	Durabilità ad alto volume e resistenza alle soluzioni di incisione alcaline.
Preparazione Campioni per Analisi di Tracce	Digestione acida e ammollo della vetreria di laboratorio per garantire una contaminazione di base pari a zero.	Profilo di rilascio ultra-basso essenziale per limiti di rilevamento a livello di PPT.
Recupero Metalli Preziosi	Utilizzo come recipiente di reazione o ammollo per la dissoluzione di metalli in acqua regia o soluzioni di cianuro.	Immunità totale all'attacco ossidativo e stabilità alle alte temperature.
Pulizia Componenti Aerospaziali	Sgrassatura e decappaggio di componenti motore ad alta precisione utilizzando agenti chimici corrosivi.	Affidabilità a lungo termine in ambienti industriali ostili con cicli di lavoro pesanti.
Sintesi Chimica Farmaceutica	Utilizzo come recipiente primario per la manipolazione di reagenti corrosivi nella produzione di farmaci ad alta purezza.	Conformità FDA e facilità di sterilizzazione grazie alla superficie antiaderente.
Ricerca e Test su Batterie	Ammollo di materiali per elettrodi in soluzioni elettrolitiche per test di invecchiamento accelerato e prestazioni.	Compatibilità chimica con vari sali di litio e carbonati organici.
Rimozione Fotoresist per Microelettronica	Rimozione di rivestimenti organici dai substrati utilizzando miscele di solventi specializzate a temperature elevate.	Mantiene l'integrità strutturale sotto stress termico ed esposizione a solventi.

Parametro	Specifica per PL-CP53
Materiale di Base	PTFE (Politetrafluoroetilene) Vergine ad Alta Densità 100%
Materiali Opzionali	PFA (Perfluoroalchossi) per una maggiore trasparenza o purezza chimica
Dimensioni (L x P x H)	Completamente Personalizzabili (Adattate allo spazio di lavoro e alla dimensione del batch del cliente)
Intervallo Spessore Parete	Personalizzabile (Standard da 5mm a 30mm+ in base al volume)
Intervallo Temperatura Operativa	da -200°C a +260°C (da -328°F a +500°F)
Compatibilità Chimica	Universale (Eccetto metalli alcalini fusi e alcuni agenti fluoruranti)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Parametro	Specifica per PL-CP53	
Metodo di Fabbricazione	Lavorazione CNC a 5 Assi / Saldatura ad Alta Precisione (se richiesto)	
Caratteristiche Interne	Deflettori, alloggiamenti per filtri e supporti a livelli personalizzabili	
Sistemi di Drenaggio	Valvole a sfera in PTFE integrate o raccordi filettati NPT opzionali	
Configurazione Coperchio	Disponibili coperchi in PTFE a sgancio rapido, a bulloni o incernierati	
Finitura Superficiale	Lavorata liscia (Ra < 0,8 µm disponibile su richiesta)	
Capacità di Carico	Progettata per supportare densità e volumi specifici del materiale	